(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年7 月28 日 (28.07.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/068134 A1

(51) 国際特許分類7: B24C 1/04, C23C 18/16, H05K 3/10

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/000623

(22) 国際出願日:

2005年1月13日(13.01.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-007043 2004年1月14日(14.01.2004) J

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友電 気工業株式会社 (SUMITOMO ELECTRIC INDUS-TRIES, LTD) [JP/JP]; 〒5410041 大阪府大阪市中央区 北浜四丁目5番33号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 林 文弘 (HAYASHI, Fumihiro) [JP/JP]; 〒5540024 大阪府大阪市此花区島屋一丁目 1番3号住友電気工業株式会社 大阪製作所内 Osaka (JP). 増田 泰人 (MASUDA, Yasuhito) [JP/JP]; 〒5540024 大阪府大阪市此花区島屋一丁目 1番3号住友電気工業株式会社 大阪製作所内 Osaka (JP). 奥田 泰弘 (OKUDA, Yasuhiro) [JP/JP]; 〒5540024 大阪府大阪市此花区島屋一丁目 1番3号住友電気工業株式会社 大阪製作所内 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 内藤 照雄 , 外(NAITO, Teruo et al.); 〒 1076012 東京都港区赤坂一丁目 1 2番 3 2号 アーク森ビル 1 2階 信栄特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

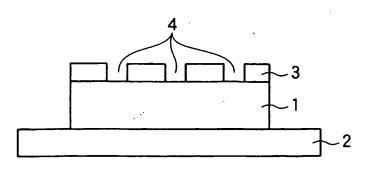
添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PRODUCTION METHOD FOR PATTERN-WORKED POROUS MOLDING OR NONWOVEN FABRIC, AND ELECTRIC CIRCUIT COMPONENTS

(54) 発明の名称:パターン加工した多孔質成形体または不織布の製造方法、及び電気回路部品



(57) Abstract: A production method for a porous molding in which complicated and fine penetrated portions and recesses are pattern-worked. A pattern-worked porous molding or non-woven fabric in which a plated layer is selectively formed on the surfaces of penetrated portions and recesses. A mask having pattern-form penetrated portions is disposed on at least one surface of a porous molding or non-woven fabric, and fluid or fluid containing abrasive grains is sprayed over the mask to form penetrated portions or recesses or the both of them, to which the opening shape of the mask's penetrated portion is transferred, on the porous molding or non-woven fabric. A porous

molding or non-woven fabric and an electric circuit components or the like in which a plated layer is selectively formed on the surfaces of penetrated portions or recesses or the both of them.

(57) 要約: 本発明の課題は、複雑かつ微細な貫通部や凹部などをパターン加工した多孔質素材の製造方法を提供すること。貫通部や凹部の表面に選択的にめっき層が形成されているパターン加工した多孔質成形体または不織布を 提供することである。本発明は、多孔質成形体または不織布の少なくとも片面に、パターン状の貫通部を有するマスクを配置し、該マスクの上から、流体または砥粒を含有する流体を吹き付けて、多孔質成形体または不織布に、マスクの貫通部の開口形状が転写された貫通部、凹部もしくはこれらの両方を形成する。該貫通部、凹部もしくはこれらの両方の表面に選択的にめっき層が形成されている多孔質成形体または不織布、電気回路部品等である。



